SEST AVAII ARI E COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-077560

(43)Date of publication of application: 25.03.1997

(51)Int.Cl.

CO4B 35/584 CO4B 35/64

(21)Application number: 07-259234

(71)Applicant: ISUZU CERAMICS KENKYUSHO:KK

(22)Date of filing:

12.09.1995

(72)Inventor: SO BUNKOU

(54) HOMOGENEOUS SILICON NITRIDE SINTERED COMPACT AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a silicon nitride sintered compact almost free from pores in the surface layer part and excellent in mechanical strength by coating the surface of a compact of a mixture of silicon nitride powder with a powdery sintering aid with a specified powdery mixture based on silicon nitride and sintering the coated compact.

SOLUTION: A mixture prepd. by adding a powdery sintering aid to silicon nitride powder is compacted, the surface of the resultant compact is coated with a powdery mixture of silicon nitride as a base with a sintering aid and a material less liable to sinter at the sintering temp. of silicon nitride, and the coated compact is sintered. At this time, Y2O3 and Al2O3 are used as the sintering aid for silicon nitride and SiC, B4C, C, nitride carbide or boride of at least one among Ta, Zr, W and Hf is used as the material less liable to sinter at the sintering temp. of silicon nitride. The surface of the compact is coated with a powdery mixture of 50–90 parts silicon nitride with 0.5–10 parts sintering aid and 10–40 parts material less liable to sinter at the sintering temp. of silicon nitride and the coated compact is sintered at 1,700–1,900° C under 8–10atm.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-77560

(43)公開日 平成9年(1997)3月25日

(51) Int. Ci. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

CO4B 35/584 35/64

CO4B 35/58 35/64

102

1

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全4頁)

(21)出願番号

特願平7-259234

(22)出願日

平成7年(1995)9月12日

(71)出額人 000125934

株式会社いすゞセラミックス研究所

神奈川県藤沢市土棚8番地

(72)発明者 曽 文甲

神奈川県藤沢市土棚8番地

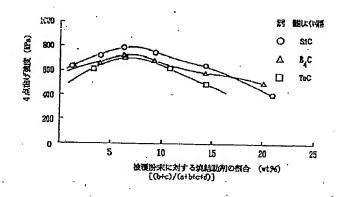
(74)代理人 弁理士 山本 俊夫

(54) 【発明の名称】均質窒化ケイ素焼結体とその製造方法

(57)【要約】

【課題】 表層部の気孔が少なく、機械的強度に優れた 均質窒化ケイ素焼結体を得る。

【解決手段】 窒化ケイ素に焼結助剤として酸化イットリウムとアルミナを添加した混合物から成形体を成形し、該成形体の表面に、窒化ケイ素50~90部と、焼結助剤0.5~10部と、窒化ケイ素の焼結温度で焼結しにくい材料10~40部とからなるセラミックス混合粉末を被覆し、温度1700~1900℃、圧力8~10atm.の窒素ガスを含む雰囲気中で焼結する。窒化ケイ素の焼結温度で焼結しにくい材料には、炭化ケイ素と、炭水・ジルコニウム・ダングステン、ハフニウムからなる群から選択された少なくとも1種の窒化物、炭化物またはホウ化物の内のいずれかを用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化ケイ素粉末に窒化ケイ素の焼結助剤粉 末を添加した混合物から成形体を成形し、窒化ケイ素を 主成分とし窒化ケイ素の焼結助剤と窒化ケイ素の焼結温 度で焼結しにくい材料とを混合した粉末を前記成形体の 表面に被覆して焼結したことを特徴とする、均質窒化ケ イ素焼結体。

【請求項2】窒化ケイ素粉末に窒化ケイ素の焼結助剤粉 末を添加した混合物から成形体を成形し、窒化ケイ素を 主成分とし窒化ケイ素の焼結助剤と窒化ケイ素の焼結温 10 度で焼結しにくい材料とを混合した被覆粉末を前記成形 体の表面に塗布して焼結してなる均質窒化ケイ素焼結体 であつて、焼成面から深さ0~200μmの表層部は、 該表層部に含まれる気孔の内径が5~50 µmであり、 200×200μmの2次元的範囲を縦横20個に分割 したセルに占める気孔面積の平均的割合が15%以下で あることを特徴とする、均質窒化ケイ素焼結体。

【請求項3】前記室化ケイ索の焼結助剤は酸化イツトリ ウム (Y, O,) とアルミナ (Al, O,) であり、前記室化ケ イ素の焼結温度で焼結しにくい材料は、炭化ケイ素(Si 20 存在し、この気孔が破壊の起点になるなど、焼成面の強 C)と、炭化ホウ素(B,C)と、炭素(C)と、タンタル (Ta), ジルコニウム(2r), タングステン(W), ハ フニウム (Hi) の内の少なくとも1種の窒化物,炭化物 またはホウ化物とのいずれかである、請求項1,2の何 れかに記載の均質窒化ケイ素焼結体。

【請求項4】窒化ケイ素を主成分とする成形体の表面 に、窒化ケイ素と窒化ケイ素の焼結助剤と窒化ケイ素の 焼結温度で焼結しにくい材料とを混合してなる被覆粉末 を被覆した後に焼成することを特徴とする、均質窒化ケ イ素焼結体の製造方法。

【請求項5】前記窒化ケイ素の焼結助剤は酸化イツトリ ウム (Y, O,) とアルミナ (Al, O,) であり、前記室化ケ イ素の焼結温度で焼結しにくい材料は、炭化ケイ素(Si C)と、炭化ホウ素(B,C)と、炭素(C)と、タンタル (Ta), ジルコニウム(2r), タングステン(W), ハ フニウム (HI) の内の少なくとも1種の窒化物, 炭化物 またはホウ化物とのいずれかである、請求項4に記載の 均質窒化ケイ素焼結体の製造方法。

【請求項6】窒化ケイ素50~90部と、窒化ケイ素の 焼結助剤 0.5~10部と、窒化ケイ素の焼結温度で焼 40 結しにくい材料10~40部とからなるセラミツクス混 合粉末を、窒化ケイ素を主成分とする成形体の表面に被 覆し、温度1700~1900℃、圧力8~10at m. の窒素ガスを含む雰囲気中で焼結することを特徴と する、均質窒化ケイ素焼結体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は表層部が緻密で強度 に優れた均質窒化ケイ素焼結体とその製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、窒化ケイ素の成形体は、焼成中 に窒化ケイ素の分解や成形体の表面付近からの焼結助剤 の蒸散により、表層部が強度の低い焼結変質層になつて いるために、強度の安定化が阻害されるという問題があ

【0003】特開平7-41367号公報に開示される 窒化ケイ素焼結体では、焼成時の窒化ケイ素と焼結助剤 成分との反応による分解を抑制するために、SiOとRE,O, (REは周期律表3A族元素)を含む窒素雰囲気中で焼成 している。また、特開平6-345536号公報に開示 される窒化ケイ素焼結体では、成形体を窒化ケイ素粉末 中に埋没した状態で焼結することにより、窒化ケイ素焼 結体の表面の硬度を高め、良好な寸法精度を得るように している。

【0004】焼成時の雰囲気を制御することは、表層部 の焼結変質層を抑制する効果を奏するが、窒化ケイ素の 柱状粒子が窒化ケイ素焼結体の表面に突出し、また窒化 ケイ素焼結体の表面に孔径数十~数百μmの気孔が多数 度が実用の域に達していないのが現状である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は上述の 問題に鑑み、表層部の気孔が少なく、機械的強度に優れ た均質窒化ケイ素焼結体を得ることにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は窒化ケイ素粉末に窒化ケイ素の焼結助剤粉 末を添加した混合物から成形体を成形し、窒化ケイ素を 主成分とし窒化ケイ素の焼結助剤と窒化ケイ素の焼結温 度で焼結しにくい材料とを混合した粉末を前記成形体の 表面に被覆して焼結したことを特徴とする。

[0007]

30

【発明の実施の形態】本発明は窒化ケイ素を主成分とす る成形体の表面に、窒化ケイ素と焼結助剤と窒化ケイ素 の焼結温度で焼結しにくい材料とを混合してなる被覆粉 末を塗布ないし被覆したうえ焼成することを特徴とす る。

【0008】窒化ケイ素の焼結助剤には酸化イツトリウ ム (Y, O,) とアルミナ (Al, O,) とを用いる。 窒化ケイ 素の焼結温度で焼結しにぐい粉末材料には、炭化ケイ素 (SiC) と、炭化ホウ素 (B,C) と、炭素 (C) のいずれ かを用いる。また、前記室化ケイ素の焼結温度で焼結し にくい粉末材料には、タンタル(Ta)の窒化物、炭化物 またはホウ化物と、ジルコニウム(21)の窒化物、炭化 物またはホウ化物と、タングステン(W)の窒化物、炭 化物またはホウ化物と、ハフニウム(HI)の窒化物、炭 化物またはホウ化物のいずれかを用いることができる。 詳しくは、窒化ケイ素を主成分とする成形体の表面を被 50 覆する波覆粉末は、窒化ケイ素粉末50~90部(重

量、以下同じ)と、焼結助剤 0.5~10部と、窒化ケイ素の焼結温度で焼結しにくい材料粉末10~40部とするのが好ましい。

【0009】前記被覆粉末は焼成中の雰囲気を抑制する。つまり、成形体の表面付近からの焼結助剤の蒸散を抑制するだけでなく、被覆粉末に含まれる焼結助剤が高温で軟化し、窒化ケイ素焼結体の表面の気孔へ充満し、気孔を閉鎖する。したがつて、破壊起因ないし破壊起点となる窒化ケイ素焼結体の表面の気孔が消滅し、窒化ケイ素焼結体の強度を実用上十分なものに高める。

[0010]

【実施例】本発明による均質化窒化ケイ素焼結体の製造方法について説明する。まず、原料として窒化ケイ素(Si,N.)と、酸化イツトリウム(Y.0,)と、アルミナ(Al.0,)との各粉末を、92:5:3の重量比で混合し、軸プレスにて成形圧力約6000kg/cm²で寸法10×15×60mmのプロツク状の成形体を作製し、該成形体に脱脂処理を施した。

【0011】次いで、前記原料粉末と同じ成分の粉末すなわち窒化ケイ素(a)と焼結助剤(b+c)と、炭化ケイ素(sic)などの焼結しにくい粉末(d)とを、90:10から10:90までの重量比で混合した被覆粉末(表1参照)を、前記脱脂処理を施した成形体の表面に塗布(コーテイング)して、厚さ約 $100\sim800\mu$ mの被膜ないし被覆層を形成した。次いで、前記被覆層を形成した成形体を、圧力約9.5atm. 温度約 $1700\sim1900$ ℃の窒素(N.)ガス中にて、約4時間にわたり焼成し、窒化ケイ素焼結体を得た。成形体の前記被覆層は、得られた窒化ケイ素焼結体から簡単に剥離できた。

【0012】得られた窒化ケイ素焼結体について、4点曲げ強度試験(JIS 1601)を行ない、窒化ケイ素焼結体の表層部の断面を走査電子顕微鏡により写真撮影した。得られた写真から窒化ケイ素焼結体の焼成面から深さ0~200 μ mの表層部断面に含まれる気孔の大きさと直径を測定した。窒化ケイ素焼結体の焼成面から深さ0~200 μ mの表層部断面は、該表層部断面に含まれる気

孔の内径が $5\sim5$ 0 μ m であり、 2 0 0 \times 2 0 0 μ m の 2 次元的範囲を縦横 2 0 等分したセル (1 0 \times 1 0 μ m) に占める気孔面積の平均的割合は 1 5 %以下であった。

【0013】本発明によれば、表1に示すように、窒化ケイ素の添加量(a)と、焼結時の雰囲気を制御する焼結助剤(b+c)の添加量と、焼結体の表面の気孔を制御する焼結しにくい材料粉末(d)の添加量とを選定することにより、表層部断面の気孔が少なく、表面の強度が高い均質窒化ケイ素焼結体が得られる。

【0014】本発明による窒化ケイ素焼結体は、表層部 断面に占める気孔面積の割合が小さく(15%以下)、 窒化ケイ素焼結体の4点曲げ強度は、表1および図1に 示すとおりであり、焼結しにくい材料を含む被覆粉末を 塗布しなかつた窒化ケイ素焼結体(比較例)に比べて曲 げ強度に優れる。

[0015]

【発明の効果】本発明は上述のように、窒化ケイ素粉末に窒化ケイ素の焼結助剤粉末を添加した混合物から成形体を成形し、窒化ケイ素を主成分とし窒化ケイ素の焼結助剤と窒化ケイ素の焼結温度で焼結しにくい材料とを混合した粉末を前記成形体の表面に被覆して焼結したものであるから、窒化ケイ素の添加量と、焼結時の雰囲気を制御する焼結助剤の添加量と、焼結体表面の気孔を抑制する焼結しにくい材料の添加量とを選定することにより、表面に気孔が少なく、表面の強度が高い均質窒化ケイ素焼結体が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る均質窒化ケイ素焼結体の被覆粉末 30 に対する焼結助剤の割合と4点曲げ強度との関係を表す 線図である。

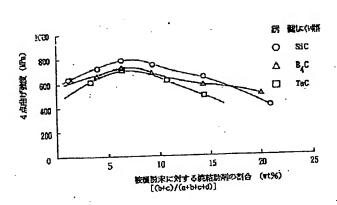
【図2】同被覆粉末におけるアルミナに対する酸化イツトリウムの割合と4点曲げ強度との関係を表す線図である。

【図3】同被覆粉末に対する焼結しにくい材料の割合と 4点曲げ強度との関係を表す線図である。

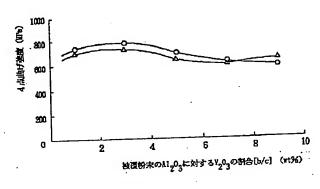
【表1】

報	被覆粉末の成分(wtX)				放置の厚さ	機能件の	are
No	(a)	(P)	(c)	(d) 融		自分支票	後の割
	Si ₃ N ₄	Y203	A1 ₂ 0 ₃	はい知	(pn)	BPa	台(%)
1	81	4.5	2. 7	SiC 10	100~400	746	8
2	64. 4	3. 5	2. 1	SiC 30	100~400	780	6
3	46	2.5	1.5	SiC 50	100~400	712	10
4	27.6	1.5	0.9	SiC 70	100~400	660	12
5	9. 2	0. 5	0.3	SiC 90	100~400	640	12
	81	4.5	2.7	B4C 10	100~500	710	8
7	64.4	3.5	2. 1	B4C 30	100~500	736	8
8	46	2.5	1.5	B4C 50	100~500	685	10
9	27. 6	1.5	0.9	B4C 70	100~500	646	12
10	9. 2	0.5	0.3	B4C 90	100~500	678	13
11	64. 4	3. 5	2.1	C 30	400~700	.592	14
12	64.4	3, 5	2. 1	TaC 30	100~400	765	7
13	64. 4	3_ 5	2.1	ZrN 30	100~200	654	10
14	64.4	3.5	2.1	TC 30	200-800	635	10
15			2.1	RfC 30	100-300	710	8
比較何	(整布粉末なし)				-	546	16





【図2】



[図3]

